

拒絶理由通知書



特許出願の番号 特願2003-164157
起案日 平成16年 6月 4日
特許庁審査官 右田 昌士 9513 2X00
特許出願人代理人 上柳 雅誉 (外 2名) 様
適用条文 第29条第2項、第37条

J0002926
US02 公報

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

理由1

この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。

記

請求項1-7に記載される発明の主要部は、画素領域における、反射電極近傍の構造であり、他の請求項に記載される発明の主要部は、これとは明らかに異なるので、特許法第37条第2号に規定する関係を有すると認められない。

また、各発明は、特許法第37条第1号、第3号、第4号、第5号に規定する関係のいずれを満たすものとも認められない。

この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項1-7以外の請求項に係る発明については新規性、進歩性等の要件についての審査を行っていない。

理由2

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

(引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項1, 7 引例1-3

請求項2, 6 引例1-4

引例 1-5

備考

請求項 1, 7 について

反射電極上に、酸化シリコンからなるパッシベーション膜を形成することは周知（例えば引例 2，3 を参照）であり、引例 1 にこのことを採用し、請求項 1，7 に係る発明とすることは、当業者にとって容易である。

請求項 2, 6 について

引例 4（図 4）に開示されている、反射電極下に絶縁膜を 2 層積層する構造を引例 1 において採用し、請求項 2，6 に係る発明とすることは、当業者にとって容易である。

請求項 3-5 について

引例 5 に開示されている、反射電極下に絶縁層を挟んで遮光膜を設ける構造を引例 1 において採用し、請求項 3 - 5 に係る発明とすることは、当業者にとって容易である。

引用文献等一覽

引例 1：特開平 8-160463 号公報 引例手配済 X

引例2：特開平8-179377号公報 引例手配済

引例3：特開平6-148679号公報

引例4：特開平1-156725号公報 引例手配済

引例 5：特開平 6—194690 号公報 引例手配済

なお、この拒絶理由に不明な点がある場合、又は、この案件について面接を希望する場合は、特許審査第1部光デバイス(光制御) 右田(特許庁内線3293)までご連絡下さい。

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 I P C 第 7 版 G 0 2 F 1 / 1 3 4 3

G 0 2 F 1 / i 3 6 2

G 0 2 F 1 / 1 3 3 3

G 0 2 F 1 / 1 3 4 5

G 0 2 F 1 / 1 3 3 5

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。